

成功大學核心設施中心 貴重儀器設備組 機台設備與費用列表

更新日期：2024/07/22

學術服務領域	儀器名稱	項目名稱	英文名稱	單位	計畫	非計畫
化學	元素分析儀	NCH	NCH	一件	250	1,800
		NCH(空敏、潮解)	NCH(Air sensitive and Deliquescent)	一件	300	3,500
		NCHS	NCHS	一件	500	3,500
		NCHS(空敏、潮解)	NCHS(Air sensitive and Deliquescent)	一件	500	4,500
		O	O	1件	250	1,800
		Cl	Cl	一件	300	2,000
		教育訓練	training course	時	800	1,000
	600MHz 核磁共振儀	氫譜	1H spectrum	件	250	1,500
		加溶劑	need solvent	件	50	200
		加試管	need tube	件	100	200
		13C及異核圖譜	13C&X nuclear spectrum	件	600	2,500
		二維圖譜	2D spectrum	件	2,000	3,000
		長時間實驗	long time exp.	小時	150	600
		教育訓練	education training	小時	1,100	2,200
	AVIII HD 700MHz 高磁場超導核磁共振儀	氫譜	1H	件	250	1,800
		氫譜(含溶劑及試管)	1H(solvent + tube)	件	350	2,000
		異核圖譜及二維圖譜	1D nuclear and 2D spectrum	小時	350	1,800
		夜間時段或長時間檢測	overnight or long time test	小時	150	1,200
		700NMR 教育訓練	700NMR education training	小時	450	900
	固態核磁共振光譜儀	一般光譜及二維光譜	1D&2D spcetrun	小時	150	1,800
		教育訓練	training course	時	900	1,100
	超導核磁共振儀 500NMR	氫譜	1H	件	150	600
		氫譜(含溶劑及試管)	1H(solvent + tube)	件	200	600
夜間時段或長時間檢測		overnight	小時	100	600	
異核圖譜及二維圖譜		13C or 2D	小時	200	1,200	
500NMR教育訓練		500NMR education training	小時	450	900	
高解析感應耦合電漿質譜分析儀	1-3元素	1-3元素	件	200	3,000	
	4-6元素	4-6元素	件	350	5,000	
	7-10元素	7-10元素	件	500	7,500	
	11-20元素	11-20元素	件	1,000	15,000	
	21-30元素	21-30元素	件	1,600	20,000	
	31個以上元素	31個以上元素	件	3,000	25,000	
	半定量(約65個元素)	半定量(約65個元素)	件	350	2,500	
教育訓練	Education training	小時	300	500		
微波加速反應系統	微波消化	Microwave Digestion	台幣	200	800	
X光光電子能譜儀-XPS	XPS委託操作	survey scan	件	350	3,500	
	紫外光光電子能譜	UPS	件	350	3,500	
	低能量反轉電子能譜	LEIPS	小時	650	6,500	
	AES 委託操作	AES scan	件	350	3,500	
	GCIB縱深分析	depth frofile(GCIB)	小時	650	6,500	
	超時計費	overtime charge	20分鐘	150	1,500	
	縱深分析Ar	Depth Profile(Ar)	小時	650	6,500	
化學分析電子光譜儀 ESCA	表面分析	survey scan Chemical Shift	小時	450	3,500	
	教育訓練	training	1小時	850	1,200	
	縱深分析	Depth Profile	小時	550	4,000	
高解析Orbitrap質譜儀 串聯液相層析暨晶片電泳分析系統	ESI分子量測定 (Loop, 1-9次進樣)	Molecular weight determination (Loop, 1-9 injection)	一次進樣	500	2,000	
	ESI分子量測定 (Loop, 10次以上進樣)	Molecular weight determination (Loop, above 10 injection)	一次進樣	350	1,400	
	RPLC-MS/MS分析 (1-9次進樣)	RPLC-MS/MS analysis (1-9 injection)	一次進樣	800	3,200	
	RPLC-MS/MS分析 (10次以上進樣)	RPLC-MS/MS analysis (above 10 injection)	一次進樣	600	2,400	
	nanoLC-MS/MS分析 (蛋白質體分析, 1-9次進樣)	nanoLC-MS/MS analysis (Proteomics, 1-9 injection)	一次進樣	1,500	4,500	
	nanoLC-MS/MS分析 (蛋白質體分析, 10次以上進樣)	nanoLC-MS/MS analysis (Proteomics, above 10 injection)	一次進樣	1,100	3,300	
	Mascot資料庫比對(限成大數據, 定性)	Mascot database search (NCKU analyzed data only, Qualitative)	檔案	300	900	
	RPLC-MS/MS分析 (日間自行操作12小時)	RPLC-MS/MS analysis (Daytime usage: 12 hrs)	次	6,500	26,000	
	RPLC-MS/MS分析 (夜間/假日自行操作12小時)	RPLC-MS/MS analysis (Night/Weekend usage: 12 hrs)	次	4,500	18,000	
	nanoLC-MS/MS分析 (日間自行操作12小時)	nanoLC-MS/MS analysis (Daytime usage: 12 hrs)	次	7,500	30,000	
	nanoLC-MS/MS分析 (夜間/假日自行操作12小時)	nanoLC-MS/MS analysis (Night/Weekend usage: 12 hrs)	次	5,500	22,000	
教育訓練	Training	小時	450	1,000		
高解析四極桿飛行時間串聯質譜儀	RPLC-MS/MS 分析(自行操作12小時)	RPLC-MS/MS analysis (12 hrs usage)	次	4,000	16,000	
高解析氣相層析飛行質譜儀	EI低解析	EI-low-resolution	一個	150	1,500	
	EI高解析	EI-high-resolution	一個	200	2,000	

		FAB低解析	FAB-low-resolution	一個	200	2,000
		FAB高解析	FAB-high-resolution	一個	270	2,700
		FD低解析	FD-low resolution	一個	180	1,800
		FI	Field Ionization	一個	300	3,000
		GCMS-CI	GCMS-CI	半小時(基本收費)	300	3,000
		GC/MS	GC/MS	0.5小時(延長)	50	500
		GC/MS	GC/MS	半小時(基本收費)	350	3,000
		GC/MS 數據處理	GC/MS data processing	0.5小時(延長)	50	700
		GCMS 教育訓練	GCMS education training	小時	800	1,000
材料	小角度X光散射儀 (SAXS/WAXS&變溫)	夜間使用費	night charge	小時	150	
		非計畫 - 夜間使用費	night charge (OEM)	小時		300
		非計畫 - 基本使用費	base charge (OEM)	小時		600
		基本使用費	base charge	小時	250	
		開機使用費	base charge	小時	200	400
	低掠角薄膜 X 光繞射儀	自行操作	self-operation	時段(兩小時)	450	450
		委託操作	OEM	時段(兩小時)	800	800
		基本使用費	base charge	hr	50	100
		無計劃委託操作	OEM(Industry)	時段(兩小時)	4,000	4,000
		超時計費	excess time charge	次	150	300
	高強度多功能X光 薄膜微區繞射儀	資料檢取-TOPAS	TOPAS	次	200	400
		Reflectivity	Reflectivity	元/1小時	400	3,000
		Rocking Curve	Rocking Curve	元/1小時	400	3,000
		低掠角繞射(2Theta) & 一般繞射(2Theta/Theta)	Glazing angle XRD	元/20分	150	1,000
		粉末處理費	additional cleaning fee for powder	元/件	50	100
	高溫二維X-ray 廣角繞射 儀(粉末X光二維繞射儀)	高溫分析	H.T. XRD	400/小時(最少10小時)	400	3,000
		教育訓練	training	元/1小時	400	3,000
		殘留應力分析	Residual Stress	元/2小時	800	5,500
		極圖分析	Pole Figure	元/2小時	800	5,500
		委託操作	OEM	時段(兩小時)	800	
	單晶X-光繞射儀	基本使用費	base charge	時段(兩小時)	200	400
		無計劃委託操作	OEM(Industry)	時段(兩小時)		4,000
		超時計費	excess time charge	次(現金)	150	300
		資料檢取-TOPAS	TOPAS	次	200	400
		Index crystal phase	Index crystal phase	小時	1,000	3,000
	分析型場發掃描式 電子顯微鏡	教育訓練	Training	堂	5,000	15,000
晶格常數分析		Index crystal	件	350	1,200	
結構解析		Solve structure	件	600	2,000	
超過兩小時數據收集費用(時)		data collected over than 2 hour (hr)	小時	100	300	
數據收集(低溫)		collect data (air cooling)	兩小時	800	5,000	
樣品處理(含空氣敏感)		Select & Mount the Crystal (Including air-sensitive samples)	件	250	1,200	
繞射數據收集		collect data	2小時	600	3,000	
AFE-SEM基本收費		Analytical field emission scanning electron microscope	1小時	400	3,000	
EDS元素分析		EDS analysis	次	100	200	
教育訓練-初階		training	次	1,000	1,500	
自行操作	導電金膜(Au)蒸鍍	Electric conduction gold membrane evaporator	次	100	200	
	AFE-SEM基本收費	Analytical field emission scanning electron microscope	1小時	350	2,000	
多功能環境場發掃描式 電子顯微鏡	SEM基本收費	SEM basic charge	1小時	350	3,000	
	元素分析	element analysis	次	100	200	
	真空鍍金(Au)	vaccum gold-plating	次	100	200	
	教育訓練-初階	training	次	1,000	1,500	
	電子背向繞射儀(EBSD)	EBSD analysis	1小時	200	2,500	
自行操作	SEM基本收費	SEM basic charge	1小時	300	2,000	
前瞻聚焦離子束系統	in situ lift out 耗材費	in situ lift out parts fee	片	200	550	
	in-situ lift out	in-situ lift out	小時	250	1,600	
	TEM grid	TEM grid	片	110	200	
	TEM試片製作(委託操作)	TEM sample preparation (Commissioned operation)	片	3,900	13,000	
	加收費用_EDS	Plus fees_EDS	小時	300	1,050	
	教育訓練	Training course	小時	1,320	2,000	
	鍍導電層 Pt	Pt coating	次	120	200	
	離子束顯微鏡	Ion beam Microscopy	小時	2,050	6,300	
	EDS	EDS fee	小時	200	1,000	
	離子束顯微鏡	Ion beam Microscopy	小時	1,100	2,000	
	高解析穿透式 電子顯微鏡	CCD照相使用時間	CCD photo	小時	250	1,400
		JEOL-2100F Cs STEM委託操作	JEOL-2100F Cs STEM Request operation	小時	500	1,200
化學元素能譜分析		EDS	小時	150	650	

自行操作	高效能等離子清潔機	plasma cleaner	小時	100	300		
	高解析成像分析	lattice image	小時	100	450		
	教育訓練	Training Course	小時	1,000	1,500		
	微束統射分析	nano diffraction	小時	100	450		
	電子能量損失能譜分析	EELS	小時	150	600		
	燈絲使用時間	filament charge	小時	750	2,000		
	CCD照相使用時間	CCD photo	小時	200	700		
	JEOL-2100F Cs STEM 自行使用	JEOL-2100F Cs STEM Super User	小時	150	500		
	化學元素能譜分析	EDS	小時	100	300		
	高效能等離子清潔機	plasma cleaner	小時	100	200		
	高解析成像分析	lattice image	小時	100	300		
	微束統射分析	nano diffraction	小時	100	300		
	電子能量損失能譜分析	EELS	小時	150	400		
	燈絲使用時間	filament charge	小時	150	500		
	CCD照相使用時間	CCD photo	小時	250	1,400		
	E-chip基本組裝費(不含晶片)	E-Chip Assembly charge	組	700	2,100		
	加熱功能	heating function	小時	300	900		
	空氣敏感樣品製備	air sensitive sample preparation	次	700	2,100		
	教育訓練-液態樣品穿透式電子顯微鏡簡介	course-Introduction of liquid cell TEM	小時	300	900		
	液態樣品	液體樣品觀測(流動態)	Liquid Cell TEM (Flow)	小時	1,500	4,500	
液體樣品觀測(靜態)		Liquid Cell TEM (Static)	小時	1,200	3,600		
電化學功能		Electrochemical function	小時	300	900		
燈絲使用時間		filament charge	小時	750	2,000		
自行操作		高解析掃描電子顯微鏡	EDS(5060)	次	300	600	
			EDS(5010)	次	100	200	
			儀器教育訓練(初階)	instrumental education training	次	1,000	1,500
			燈絲使用費1小時	HR-SEM basic charge	1小時	450	3,000
			鍍金	Pt coating	次	100	200
			研磨拋光機	Grinding and polishing machine	小時	200	600
		鑲埋機	Mounting Press Machines	小時	200	600	
		燈絲使用費	HR-SEM basic charge	1小時	360	2,000	
		軟物質穿透式電子顯微鏡	time of CCD	小時	150	500	
		JEOL-JEM1400委託操作	JEOL-JEM1400 outsource	小時	450	2,500	
自行操作		教育訓練(低階)	training (low level)	次	1,500	3,000	
		教育訓練(高階)	training (high level)	次	8,000	12,000	
		JEOL-JEM1400自行操作	JEOL-JEM1400 self	小時	350	1,500	
		JEOL-JEM1400自行操作(夜間)	JEOL-JEM1400 self (night)	小時	200	800	
自行操作	多功能低電壓穿透式電子顯微鏡	基本費	Multifunctional Low-Voltage Transmission Electron Microscope_Basic	小時	650	3,250	
		EDS使用費	Multifunctional Low-Voltage Transmission Electron Microscope_EDS	小時	150	750	
		基礎使用者教育訓練與認證課程	Basic user training course	堂	5,000	25,000	
		STEM使用者教育訓練與認證課程	STEM user training course	堂	3,500	17,500	
自行操作		基本費	Multifunctional Low-Voltage Transmission Electron Microscope_Basic_licensed use	小時	300	1,500	
		EDS使用費	Multifunctional Low-Voltage Transmission Electron Microscope_EDS_licensed user	小時	150	750	
奈米製程	電子束蒸鍍機薄膜沉積系統	代工服務	E-beam Evaporation Deposition System	一小時	2,400	12,000	
		自行操作	E-beam Evaporation Deposition System	一小時	2,400	12,000	
		訓練課程	E-beam Evaporation Deposition System	堂	3,200	12,500	
		認證	E-beam Evaporation Deposition System	堂	1,100	4,500	
	感應耦合式高密度電漿蝕刻機	代工服務	ICP RIE System, Chlorine base	一小時	3,015	12,000	
		自行操作	ICP RIE System, Chlorine base	一小時	2,000	8,000	
		訓練課程	ICP RIE System, Chlorine base	堂	4,480	21,000	
		認證	ICP RIE System, Chlorine base	堂	2,400	9,600	
	電子束微影系統(EBW)	代工服務	Electron Beam Lithography System	一小時	2,430	10,000	
		自行操作	Electron Beam Lithography System	一小時	1,760	7,000	
	訓練課程	Electron Beam Lithography System	堂	16,000	64,000		
	認證	Electron Beam Lithography System	堂	5,040	20,000		
電子束微影系統(SEM)	代工服務	Electron Beam Lithography System	一小時	1,980	8,000		
電子束微影系統(Ultra)	代工服務	Electron Beam Lithography System	一小時	3,780	12,000		
	訓練課程	Electron Beam Lithography System	堂	16,000	64,000		
	認證	Electron Beam Lithography System	堂	5,040	20,000		
電子束微影系統(鄰近效應修正軟體)	代工服務	Electron Beam Lithography System	一小時	2,430	10,000		
	自行操作	Electron Beam Lithography System	一小時	600	3,000		
物理	氬液化系統	液氬補保溫層抽真空服務	evacuation	桶	1,000	2,000	
		液氬補降溫處理操作費	precooling	桶	1,000	2,000	
		液態氬操作費	Liquid helium	每公升100元	100	250	
		氬氣回收純化	Helium purification	每公升30元	30	150	

	氦氣管線測漏	Helium pipeline leak detection	每小時600	600	1,600
物理性質量測系統儀	比熱量測(變溫及變場)	Heat capacity	小時	450	2,500
	更換樣品	Change sample	件	250	1,200
	稀釋製冷系統	Dilution refrigerator	小時	450	2,500
	電阻量測(變溫、變場及霍爾)	Resistance measurements	小時	450	2,500
	磁化率(交流、直流、變溫及變場)	Susceptibility	小時	450	2,500
	熱電量測(熱傳導、西貝克係數、熱電係數、變溫及變場)-複製	Thermoelectricity	小時	450	2,500
	壓力下電阻量測(變溫、變場及霍爾)	Resistance measurements under pressure	次	20,000	20,000
超導量子干涉磁化儀	iQuantumHe3開機費	iQuantum He3 fee	小時	450	2,500
	氦三使用費	He3 fee	件	4,000	5,000
	更換樣品	sample changing	件	100	1,200
	特殊樣本封裝	particular sample prepare	件	400	1,200
	粉末樣本壓錠	sample prepare-Ingot	件	650	3,250
	高溫套件	high temperature	時	250	2,500
	高壓艙使用費	high pressure cell	一件樣品	20,000	20,000
	磁滯曲線/磁化率(磁場5T以下)	MH/MT(<5T)	時	400	1,600
	磁滯曲線/磁化率(磁場5T以上)	MH/MT(5T<)	時	600	2,000
	SQUID教育課程	SQUID Training Course	堂	1,700	3,400
瞬態吸收光譜儀	瞬態吸收光譜	Transient Absorption	時	1,000	3,000
	雷射誘導螢光分析	Laser-Induced Florescence	時	1,000	3,000
	時變的吸收或螢光全光譜	Absorption or Fluorescence mapping	件	3,000	13,500
	機台教育訓練	TAS Training (Certification included)	次	3,000	13,500
自行操作	雷射誘導螢光/穿透吸收	Superuser	時	500	1,500

儀器服務項目一覽

國科會 - 預約服務管理系統

